(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-243261

(43)公開日 平成4年(1992)8月31日

0 3 F 7/029 9019-2H 0 3 C 1/735 8910-2H 0 3 F 7/004 5 0 3 7124-2H	
0 3 F 7/004 5 0 3 7124-2H	
031 1/004 000	
6 1 7 01/007	
0 1 I. 21/027	
7352-4M	H 0 1 L 21/30 3 0 1 R
**	特査請求 未請求 請求項の数3(全10頁) 最終頁に続く
出願番号 特顯平3-19478	(71) 出源人 000222118
1100.00	東洋インキ製造株式会社
出願日 平成3年(1991)1月18日	東京都中央区京橋2丁目3番13号
	(72)発明者 鳥羽 泰正
	東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ
	ンキ製造株式会社内
	(72)発明者 安池 円
	東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ
	ンキ製造株式会社内
	(72)発明者 山口 岳男
	東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ
	ンキ製造株式会社内

(54) 【発明の名称】 光開始剤組成物

(57) 【要約】

【目的】本発明は、600nm~720nmの波長の光 に対して優れた感光性を有する高感度な光過酸化物形成 型光開始剤組成物を提供することを目的とする。

【構成】少なくとも一種以上の下記一般式(1)で表わ されるポルフィラジン系化合物(A)、少なくとも一種 以上の光酸化性化合物 (B)、及び少なくとも一種以上 の酸化還元触媒(C)とから成る光過酸化物形成性ラジ カル発生剤とを含有してなる光開始剤組成物。

一般式 (I) (化1)

【特許請求の範囲】

【前求項1】 少なくとも一種以上の下記一般式(1) で表わされるボルフィラジン系化合物(A)、少なくと 一種以上の光酸化性化合物(B)、及び少なくとも一 種以上の酸化週元触媒(C)とから成る光過酸化物形成 性ラジカル発生剤とを含有してなる光質的剤能成物。一 存式(1)

(化1)

(式 (1) 中、栗A¹ ~A¹ は、それぞれ独立に、 【化2】

を表わすが、環 $A^1 \sim A^4$ すべてが同時に、 【化3】

となることはない。 R¹ ~ R¹¹はそれぞれ独立に、木素原子、ハロゲン原子ならびに水素原子およびハロゲン原子ならびに水素原子およびハロゲン原子以外の有機残差を表わし。 R¹ と R¹¹、 R¹¹ と R¹¹、 R¹¹ と R¹¹、 R¹¹ と R¹¹、 R¹¹ と R¹¹ 水 R¹¹ な R¹¹ な R¹¹ か R¹¹ な R¹¹ な

【請求項2】 光酸化性化合物(B)が、一重項酸素 と反応して光温酸化物を形成することのできる、二重結 台炭素上に少なくとも1つ以上のメチル基を有するオレ フィン化合物であることを特徴とする請求項1記載の光 開始剤組成物。

【請求項3】 酸化還元強媒(C)が、2以上の原子価 50 nm以上の長波長光に対する感光性が低いこと、またア

状態で存在することのできる金属の塩または錐体である ことを特徴とする請求項1記載の光開始剤組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001] [産業上の利用分野] 本発明は、重合性の不酸和化合物 を光重合する時の、新規な光陽始剤組成物に関し、さら に詳しくは、600nmから720nmまでの被長の光 に対して低光量で感光する高感度光過酸化物形成性ラジ カル発生剤とを含有してなる光陽始剤組成物に関するも 10 のである。

[0002]

【従来の技術】エチレン性不飽和齢合を分子内に含むモノマー、オリコマー、ボリマーが光開始剤の存在下で光 風合する事は良く知られており、この現象は、印刷製版、プリント基板、インキ、強料、ワニス、フォトレジスト等に広く利用されている。またレーザー形を用いたの機能が成構、例えばホログラム配線左ぐ年報近代わる非規塩タイプの感光材料等としても往目されている。

[0003] このような材料として用いられる感光材料 20 においては、感光速度をできるだけ高める事が、その性能にとって重要で多くの研究がなされている。

30 [0005]また近年になって、より短波長(670 m以下)に発抵波長をもった高田力(数十m以上)の 半導体レーザーも開発されてきており、従来のものより 長波長(600 m以上)の光に対して低光量で感光す る高級度な感光材料の開発が望まれる。

[0006] 一方、日e-Neレーザーに対して、高い 総光性を示すメテレンブルー、pートルエンスルホン酸 及びアクリル酸パブウムから成る光硬化性組成物が提案 されているが [「フォトグラフィッシ・アンド・サイエ ンティフィク・エンジニアリング (Photon: Set. IB (08.) 」第12巻、第177ページ (1968年)]、こ のものは現火性であって製油性の刺動組成物には落さな いという欠支がある。

【0007】また、He→NeレーザーやKTレーザー ・ 半導体レーザーのような接続光源に対して感光性 をもつ鏡前性の大髪化性機関振成物として、ポルフィリン類、アザボルフィリン類、アタロシアニン類またはそ の金属婦体とジアリールコードニウム塩との組合性を光 混合開始剤とする現成物が提集されているが、体開昭6 0−78442号公翰)、該ポルフィリン類では50分 のm以上の接触光に対する数学性が低いンと キャマ ザポルフィリン類では増感効率が低いこと、フタロシア ニン類では、種々の有機溶媒への溶解性が低いことが間 類として残っている。

【0008】また、テトラペンプポルフィリン類と電子 受容性ラジカル発生剤との組合せから成る光硬化性樹脂 組成物も提案されているが (特開昭63-243102 号公報)、テトラペンゾポルフィリン類はその工業的規 模での合成法はまだ確立されていないという問題があ

【0009】また一方では、特公昭58-42459号 10 公報にて、光酸化性組成物と光酸化性増減剤とから成る 感光性組成物を用いる印刷版の製造方法が提案されてい る。

[0 0 1 0]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記試 みにおける、これら光重合開始剤を用いた感光性組成物 の感度特性を高くするためには、光重合反応を抑制する 酸素を光照射時に遮断する必要があり、ドライフィルム 状にするか、あるいは感光層上に酸素阻害層、例えばポ リピニルアルコール皮膜を設けて使う必要があり、取扱 20 性、経済性に難点があった。

【0011】また、後者の光酸化性組成物と光酸化性増 感剤とから成る感光性組成物においては、光酸化性増感 割の衝々溶媒に対する溶解性、光酸化性組成物を光酸化 して渦酸化物を生成せしめる能力、またはレーザー光源 との波長マッチング性などの何れかあるいは全てにおい て必ずしも満足できるものではなく、そのため感度特性 において不十分であり、レーザーの高速走査露光に耐え るものではなかった。

物や光重合性組成物が有する欠点を克服し、600nm ~720nmの波長の光に対して優れた感光性を有する 高感度な光過酸化物形成型光開始剤組成物を提供するこ とを目的としてなされたものである。

[0 0 1 3]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、以上の諸 点を考慮し、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、 特定の構造を有するポルフィラジン系化合物(A)、少 なくとも一種以上の光酸化性化合物 (B)、及び少なく とも一種以上の酸化還元触媒 (C) とを組み合わせるこ 40 とにより、前記目的を達成することを見いだし、この知 見に基づいて本発明を完成するに至った。

【0014】すなわち、第一の発明は、少なくとも一種 以上の下記一般式(1)一般式(1)

[0015]

(化4]



【0016】(式(I)中、環A'~A'は、それぞれ 独立に、

[0017] [化5]

【0018】を表わすが、環A¹~A¹すべてが同時 K,

[0019] 14:61

[0020] となることはない。

[0021] R1 ~ R12 はそれぞれ独立に、水素原子、 ハロゲン原子ならびに水素原子およびハロゲン原子以外 【0012】 本発明は、このような従来の光開始剤組成 30 の有機残基を表わし、R1とR2、R1とR4、R4と R5 , R6 &R7 , R9 &R10, R10 &R11, R11 &R 12がそれぞれ一体となった環状構造であってもよい。 【0022】Mは、2つの水素原子あるいは置後基を持

- っていてもよい2価以上の価数をもつ原子を表わす。 100231 Yおよび2は、それぞれ独立に、ハロゲン 原子、 酸素原子ならびにハロゲン原子、酸素原子以外の 有機残基を表わすが、このうち、Mと直接結合している 有機残基中の原子は、酸素原子、窒素原子、炭素原子ま たは硫黄原子に限られる。
- 【0024】1およびmは、それぞれ独立に0または1 の整数を表わす。) で表わされるポルフィラジン系化合 物(A)、少なくとも一種以上の光酸化性化合物 (B) 及び少なくとも一種以上の酸化還元触媒(C) とから成る光過酸化物形成性ラジカル発生剤を含有して なる光顆始剤組成物である。
 - 【0025】第二の発明は上記光酸化性化合物 (B) が、一重項酸素と反応して光過酸化物を形成することの できる、二重結合炭素上に少なくとも1つ以上のメチル 基を有するオレフィン化合物である。
- 50 【0026】第三の発明は、上記酸化還元触媒 (C)

が、2以上の原子価状態で存在することのできる金属の 塩または錯体である。

【0027】以下詳細に本発明を説明する。

【0028】一般式(1)における置換基について説明 すると、R! ~R!1は、それぞれ独立に、水素原子、ハ ロゲン原子、および水素原子ならびにハロゲン原子以外 の有機残基を表わす。このうち、ハロゲン原子として は、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等で あり、また水素原子ならびにハロゲン原子以外の有機残 換基を持っていてもよいアリール基、置換基を持ってい てもよいピニル基、ニトロ基、水酸基、置換基を持って いてもよいアルコキシ基、置換基を持っていてもよいア リールオキシ基、置換基を持っていてもよいアシルオキ シ基、置換基を持っていてもよいアシル基、カルボン酸 其、カルボン酸ニステル基、カルバモイル基、メルカブ ト基、置換基を持っていてもよいアルキルチオ基、置換 基を持っていてもよいアリールチオ基、置換スルフィニ ル基、置換スルホニル基、スルホン酸基、スルホン酸エ オカルパモイル基、シアノ基、置換基を持っていてもよ いアミノ基、置換アゾ基、置換基を持っていてもよいホ スフィノ基、置換基を持っていてもよいホスホノ基、置 換シリル基、置換シロキシ基、置換基を持っていてもよ い複素環基等であるが、これらの置換基に限定されるも のではない。

【0029】さらに、上記の有機残基について詳細に説明すると、概拠基を持っていてもよいアルキル基としては、メチル基、エデル基、ロープチル基、tertープチル基、オクテル基、ステアリル基、シクロヘキシル基、メ 20 ンチル基、ポルニル基、アリル基、ベンジル基、トリフルオロメチル基、トリクロロメテル基、メトキシメチル基、カルポキシメチル基、ヒドロキシメチル基等であり、

【0030】 情換基を持っていてもよいアリール基としては、フェニル基、トリル基、ナフテル基、カメニル基、トリクロフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メシチル基、カルボキシフェニル基等であり、

[0031] 置換基を持っていてもよいピニル基として は、ピニル基、プテニル基、2-プロモエテニル基、2-カ 40 ルポキシエテニル基等であり、

【0032】 置換基を持っていてもよいアルコキシ基と しては、メトキシ基、エトキシ基、tert- ブトキシ基、 ペンジルオキシ基、2-ヒドロキシエトキシ基等であり、

【0033】 関換基を持っていてもよいアリールオキシ 基としてはフェノキシ基、2.4.6 トリメチルフェノキシ 基、4-プロモフェノキシ基、ナフテルオキシ基等であ n.

【0034】 假機基を持っていてもよいアシルオキシ基 状構造であってもよく、例えば、トリメチレン基、テーとしては、アセトキシ基、ペンゾイルオキシ基、フォル 50 ラメチレン基等のアルキレン基、エチレンジオキシ基、

ミルオキシ基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイル オキシ基等であり、

【0035】 置換基を持っていてもよいアシル基として は、ホルミル基、アセチル基、ブチロイル基、ラウロイ ル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、オレオイル 基、ペンソイル基、シンナモイル基等であり、

【0036】カルボン酸エステル基としては、メトキシ カルボニル基、エトキシカルボニル基、フェノキシカル ボニル基等であり、

【0038】 置換基を持っていてもよいアリールチオ基 としては、フェニルチオ基、4-メトキシフェニルチオ 基、ナフチルチオ基等であり、

【0039】 置換スルフィニル基としては、メチルスルフィニル基、フェニルスルフィニル基、ヒドロキシエチルスルフィニル基等であり、

ル基、置換スルホニル基、スルホン酸基、スルホン酸エ ステル基、チオカルボン酸基、ジナルルボン酸基、 2カールエネール基、ペンゼンスルフォニル基、トシル基、スルフ ナカルパネモル基、シア1馬、野常恵外帯でいたでもよ アモイル基等であり、

[0041] スルホン酸エステル基としては、メトキシ スルフォニル基、エトキシスルフォニル基、フェノキシ スルフォニル基等であり、

[0042] 恒娘基を持っていてもよいアミノ基として は、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ア ニリノ基、トルイジノ基等であり、

[0043] 関換アゾ基としては、フェニルアゾ基、ナフチルアゾ基等であり、

80 【0044】置換基を持っていてもよいホスフィノ基と しては、ジメチルホスフィノ基、ジフェニルホスフィノ 基等であり、

[0045] 置換基を持っていてもよいホスホノ基としては、ホスホノ基、ジメチルホスホノ基、ジフェニルホスホノ基等であり、

【0046】 置換シリル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基等であり、

[0047] 置換シロキシ基としては、トリメチルシロ キシ基、トリエチルシロキシ基等であり、

【0048】 置換基を持っていてもよい複葉限基として は、フリル基、チェニル基、ピリジル基、ピロリル基、 ピペリジノ基、モルホリノ基、メチルキノリル基、フェ ニルチテゾリル基、クロペングチアゾリル基、メチル オキサゾリル基、メチルイミダゾリル基等であるが、こ れらの関後系に収定されるものではない。

【0049】また、一般式(1)において、R'とR*、R*とR*、R*とR*、R*とR*、R*とR*、R*とR*、R*とR*、R*とR、、R*とR、、R*とR、、R*とR、、R*とR、、R*とR、、R*とR、、R*とR、、R*とR、R*とR、R*とVを、R*とNとWを、R*といる。

エチレンジアミノ基等の他に、

[0050] [457]

(0051) 等があるが、これらの置換基に限定される 10 ものではない。

【0052】また、一般式 (I) において、Mは、2つ の水素原子あるいは置換基を持っていてもよい2価以上 の原子を表わし、Zn、Pd、Cd、Mg、A1、T 1、Ge、Sn、V、S1等が挙げられる。

【0053】また、YおよびZは、それぞれ独立に、ハ ロゲン原子、酸素原子ならびにハロゲン原子、酸素原子 以外の有機残基を表わすが、例えばハロゲン原子として は、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等で あり.

[0054] また、ハロゲン原子、酸素原子以外の有機 残基としては、置換基を持っていてもよいアルキル基、 置換基を持っていてもよいアリール基、水酸基、置換基 を持っていてもよいアルコキシ基、置換基を持っていて もよいアリールオキシ基、カルボン酸基、カルボン酸工 ステル基、カルバモイル基、メルカプト基、置換基を持 っていてもよいアルキルチオ基、置換基を持っていても よいアリールチオ基、置換スルホニル基、スルホン酸 基、スルホン酸エステル基、スルファモイル基、置換基 を持っていてもよいアミノ基、置換基を持っていてもよ 30 い複素環基、-OSO2 R13基、-O-PR14 R15基、 -0 (P=O) R10 R17 基 (ただし、R13~R11 は置機 基を持っていてもよいアルキル基、置換基を持っていて もよいアリール基、水酸基、置換基を持っていてもよい アルコキシ基、置換基を持っていてもよいアリールオキ シ基、置換基を持っていてもよい複素環基である) 等で あるが、これらの置換基に限定されるものではない。

【0055】ただし、このうちMと直接結合している有 機残基中の原子は、酸素原子、窒素原子、炭素原子また は硫黄原子に限られる。光過酸化物形成性ラジカル発生 40 剤の内、(B)光酸化性化合物としては、式(II) [0056]式(11)

[化8]

【0057】(式中R1*は水素原子あるいは塩素、臭素 などのハロゲン原子を、式中R19はメチル基あるいはト 50 パルトアセチルアセトナト、ナフテン酸第1コバルト、

リフルオロメチル基を表わす。)

【0058】で表わされるジメチルシクロヘキセン化合 物 (特公昭58-42459号公報)、または式(11

1) [0059]式([]])

[48.91]

[0060] (式中R ** 及びR ** は、式(II) におけ る、それと同様の意味を示す)で表わされるトリメチル シカロヘキサジエン化合物、または、式(IV) [0061]式(IV) [(E10]

[0062] (式中R'*及びR'*は、式(III) にお ける、それと同様の意味を示す)で表わされるジメチル フラン化合物及び、式(V)

[0063]式(V)

[(E11)

20

[0064] (式中R:0及びR:0は、式(III) に おけるそれと同様の意味を示す)で表わされるトリメチ ルエチレン化合物などが挙げられる。

【0065】これらの化合物は二重結合を形成する炭素 上に少なくとも1つ以上のメチル基を持っており、この メチル基が一重項酸素と反応して過酸化物を生成する。 【0066】光過酸化物形成性ラジカル発生剤の内

(C)酸化還元触媒としては、2以上の原子価状態で存 在できる金属の塩または錯体が好ましく、例えば、オキ シアセチルアセトンパナジウム、オキシ硫酸パナジウ ム、オキシナフテン酸パナジウム、オキシテトラフェニ ルポルフィリナトパナジル、オキシオクタエチルポルフ ィリナトパナジル、オキシテトラ-t- プチルフタロシア ニンパナジル、などのオキシパナジウム塩あるいは蜡

【0067】第1コパルトアセチルアセトナト、第2コ

ナフテン酸第2コパルト、ステアリン酸第1コパルト、 ステアリン酸第2コバルト、酢酸コバルト、テトラフェ ニルポルフィリナトコパルト、オクタエチルポルフィリ ナトコパルト、テトラ-t- プチルフタロシアニンコパル トなどのコバルトの塩あるいは錯体、

[0068] ステアリン酸第1マンガン、ステアリン酸 第2マンガン、第1マンガンアセチルアセトナト、第2 マンガンアセチルアセトナト、酢酸マンガン、ナフテン 酸マンガン、テトラフェニルポルフィリナトマンガン、 オクタエチルポルフィリナトマンガン、テトラ-t- プチ 10 ルフタロシアニンマンガンなどのマンガンの塩または錯

[0069] 鉄(III) アセチルアセトナト、鉄(I II) ベンゾイルアセトナト、テトラフェニルボルフィ リナト鉄 (I I I) クロライド、オクタエチルボルフィ リナト鉄 (I I I) クロライド、テトラーナープチルフタ ロシアニン鉄(: II) クロライド、ナフテン酸鉄(I II)、フェロセン、シクコペンタジエニルークメン鉄 ヘキサフルオロフォスフェート、鉄 (II) 0-フェナン トロリンなどの鉄塩あるいは蜡体、

[0070] チタニルアセチルアセトナト、チタノセ ン、ジシクロペンタジエニルチタニウム (II) ジクロ リド、オキシチタニウムアセチルアセトナト、などのチ タン塩あるいは蜡体などが挙げられる。

【0071】本発明で使用する上記一般式(I)で表わ されるポルフィラジン系化合物は、一般には下記式(V I)~ (IX) で表わされるニトリル類 ((IX) のみ の単独使用では目的物は得られない)と各種金属塩(無 金属ポルフィラジンの場合は使用しないかもしくはアル 加熱することにより製造することができる[「ジャーナ ル・オブ・ジェネラル・ケミストリー・イン・USSR (J. Gen. Chen. USSR) 」、第39巻、第2477ペー ジ (1969)、特開昭64-34791号公報]。

[0072]式(VI)

(化12]

[0073] at (VII) UE 1 31

[0074]式(VIII)

ME 1 41

【0075】式(IX)

(化15)

20

【0076】また、上記式 (VI) ~ (IX) で示され る置換基の異なるニトリル類を混合して反応させること によって薄々のポルフィラジン系化合物を得ることもで きる。

【0077】また一般式(I)のポルフィラジン系化合 物は、下紀式 (X) ~ (X I I I) で表わされるイソイ ンドリンジイミン誘導体((XIII)のみの単独使用 では目的物は得られない) からも製造することができる 「「ジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミスト カリ金属塩が用いられる) とを好ましくは有機溶媒中で 30 リー (J. Heterocycl. Chem)」、第7巻、第1403 ページ (1970) 、日本化学会誌、第219ページ (1990年)]。

[0078] 式(X)~(XIII) [/K.16]

40

20

30

(7)

【0079】 本発明で使用する一般式(I)で表わされ るポルフィラジン系化合物の代表例(化合物(a)~ (1)) を以下に示す。

【0080】化合物(a)

(化17)

【0081】化合物(b)

(化18)

[0082] 化合物 (c)

(化19]

【0083】化合物(d) 【化20】

【0084】化合物(c)

【0085】化合物(f) [化22]

【0086】化合物(g) 【化23】

[0087] 化合物(h) 【化24]

[0088] 化合物(i)

[0089] ただし、上配化合物(a)~(!)中の略 号はそれぞれ Buがtert-ブチル基を、Mcがメチル 基を、Phがフェニル基を、Prがn-プロビル基を、 C。 Hisがn-ノニル基を表わず。

[0090]本発明の光順始新組成物は、少なくとも一 離以上の前記一般式(1)で表わされるポルフィラジン 系化合物(A)、少なくとも一種以上の光線化化合物 (B)、及び少なくとも一種以上の酸化還元無線(C) とから成ま光温酸化物が成性ラジカル発生剤を有効成分 として含有するものであり、これら三者の配行と率は重 量比で(ポルフィラジン系化合物(A)):(分離化性 化合物(B))が10~90:90~10であり、26 に舒ましては5~75:75~25であり、25 ためという。また酸化 50

14 還元無蝶(C)は、光酸化性化合物(B)に対して重量 比で0.01~90%、さらに好ましくは0.1~20 %の輸販で添加することが望ましい。

(10091) 本現明の光明を対していません。 (10091) 本現明の光照熱報度物は、ほとんどすべての重合性不飽和化合物を概期時間の別に500 nm以上の長波接光によって光温合させることができる。これらの不飽和化合動としては例えば、アクリリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸およびそのエステルや男木物、アクリルア・ド、スチレ、アクリロード、ス・ビエルとロリドン、新酸ビニル、さらに種々の

10 ル、Nーピニルピロリドン、酢酸ピニル、さらに種々の 不整和ボリエステル、不敷和ボリエーアル、不敷和ボリ ウレタン等の化合物が挙げられる。

[0092] これらの不飽和化合物の1種もしくは2種 以上の混合物に本発明の光開始剤組成物を添加し必要に 応じて通常の染料、颜料、オリゴマー、ポリマー等や適 当な希釈溶媒を加えて光風合組成物とすることができ

[0093] 光開始剤組成物の添加量は不飽和化合物の 100重量部に対して0.1~30重量部、好ましくは 200.5~20重量部である。

[0094] また、適当な看釈帝媒としては、本発明の 光開始期限法物および使用する不飽和化合物を溶解また は分散するものならすべて使用可能であり、例えば、 水、メタノール、エタノール、プロパノール、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルセロソルズ、エチルセ ロソルズ、ベンゼン、トルエン、キャンレ、テトラと フラン、ジオキサン、防撃エチル、ジクロロメタン、 クロロホルム、トリクロロエチレン、ジメチルホルムア ミド、ジメチルスルホキシド、ピリジン等が挙げられ **

[0095]

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。 説、例中部は重量語である。 実施例に ただち化合物 (a) ~ (1) の合成例を記引する。 100961 合成例1: 允合物(a) ~ (4) の合成

2-tert: ブチル・5.6・ジシアノビラジン5.00 g と無水塩 化面鉛0.95gとをキナリン30giに溶療し資素等関係が 180 でにて4時間が熱損神後、数冷、反応療を大り0gi で希釈、練別し、クロロボルムにで相出、クロロボルム /メタノールにて再結晶し化合物(a) 1.14 gを得た。 (0097) を練図:化砂砂 (b) の合改

下配に示す合物(j) 25.00kt2・(ジメデルアミノ) エタノール150 mlを加え窒素雰囲気下、撹拌しながら8 時間加熱腫液後、放冷、反放液を水300 mlで布象、練別 し、クロロホルムにて抽出、クロロホルムノメタノール にて再結晶/化合物(b) 30.0 gを得た。

【0098】化合物(j)

【化26】

合成例3:化合物(c)の合成 2,3-ジシアノ-5,6- エチレンジオキシピリジン32 gと無 水塩化カドミウム7.84g、1.8~ジアザビシクロ[5.4.0] ール150 mlに溶解し窒素雰囲気下、4時間加熱還流後、 放冷、反応液を水300ml)で希釈、濾別し、クロロホルム にて抽出、メタノールにて再結品し化合物 (c) 9.67 g を得た。

【0099】合成例4:化合物(d)の合成 4.5-ジシアノ-2- フェノキシビリジン13.3 gおよび2,6-ジメチル-3,4- ジシアノピリジン3.14 g、マグネシウム ジエトキシド4.58 gをn-アミルアルコール100 mlに溶 解し窒素雰囲気下、9時間加熱還流後、放冷、反応液を 水300ml)で希釈、濾別し、クロロホルムにて抽出、カラ 20 ムクロマトグラフィー (シリカゲル/クロロホルム) に て分離、精製し、クロロホルム/メタノールにて再結晶 し化合物 (d) 3.44 gを得た。

[0 1 0 0] 合成例 5: 化合物 (e) の合成 2.3-ジプロモ-5.6- ジシアノビラジン17.3 gおよび1,2-ジシアノ-4- ノニルベンゼン5.08 g、酢酸パラジウム4. 49 g、DBU10 gをn-アミルアルコール100ml に溶解 し窒素雰囲気下、12時間加熱還流後、放冷、反応液を 水300 mlで希釈、瀘別し、クロロホルムにて抽出、カラ ムクロマトグラフィー (シリカゲル/クロロホルム) に 30 ポリマーを得た。得られたポリマーをジオキサン中に溶 て分離、精製し、クロロホルム/メタノールにて再結晶 し化合物 (e) 3.62 gを得た。

[0101] 合成例6:化合物(f)の合成 下記で示す化合物(k)14.3 gおよび2,3-ジシアノビリ ジン2.58 g、三塩化パナジウム3.15 g、DBU7.0gをキ ノリン100 mlに溶解し窒素雰囲気下、11時間加熱還流 後、放冷、反応被をメタノール300 mlで希釈、濾別し、 クロロホルムにて抽出、カラムクロマトグラフィー(シ リカゲル/クロロホルム) にて分離、精製し、クロロホ ルム/メタノールにて再結晶し化合物 (f) 2.80 gを得 40 た。

【0 1 0 2】化合物(k) 【化27】

[0103] 合成例7:化合物(g)の合成 2.3-ジシアノ-5.6- ジプロポキシピラジン14.28gおよび 4,5-ジシアノ-2- メテルチオピリジン3.5g、塩化アルミ 50 ンコーターを用いて約2μmの厚みにガラス板上に塗布

ニウム5.34 g、DBU8gをキノリン100 mlに溶解し窒素 雰囲気下、8時間加熱還流後、放冷、反応液をメタノー ル300mlで希釈、濾別し、クロロホルムにて抽出、カラ ムクロマトグラフィー (シリカゲル/クロロホルム) に て分離、精製し、クロロホルム/メタノールにて再結晶 し化合物 (g) 2.64 gを得た。

16

【0104】合成例8:化合物(h)の合成

4.5-ジシアノニコチン酸5.13 gおよび2-カルポキシル-5,6- ジシアノビリジン1.71 g、酢酸鉛三水和物7.59 ウンデク-7- エン (DBU) 20 gとをnーアミルアルコ 10 g, 1,4-ジアザビシクロ[2,2,2] オクタン3gをニトロベ ンゼン100 mlに溶解し窒素雰囲気下、15時間加熱還流 後、放冷、反応液をヘキサン100 mlで希釈、濾別し、メ タノールにて抽出、逆相カラムクロマトグラフィー(オ クタデシル化学修飾シリカゲル/エタノール) にて分 離、精製し、メタノールにて再結晶し化合物(h)11.7 gを得た。

【0 1 0 5】合成例9:化合物 (i) の合成 2.3-ジシアノ-4- ジメチルアミノビリジン15.5 gおよび 1, 2-ジシアノ-3, 4, 5, 6- テトラフルオロベンゼン12. 61 g、酢酸ナトリウム12 gをn-アミルアルコール200 ml に溶解し窒素雰囲気下、12時間加熱週流後、放冷、反 応液を水400 mlで希釈、濾別し化合物 (1) 2.31 gを得

た。 【0106】 クロロメチルスチレンとメタクリル酸メチ ルをモル比1:1の割合で有する共重合体と、アクリル 酸カリウム塩とを、ジメチルホルムアミド40m1中 で、テトラプチルアンモニウムクロライドと炭酸カリウ ムとを相間移動触媒として酸素ガスパプリング下、40 ℃で12時間反応させ、アクリロイル基を側鎖に有する 解して、5 重量%濃度の溶液に調製し、以後感度特性評 価用の樹脂として用いた。

[0107] 実施例1~9

本実施例は下記の、ジメチルシクロヘキセンのピスフェ ノール誘導体 (XIV) を光酸化性化合物として使用す る場合の例である。

【0108】 ピスフェノール誘導体(XIV) (K28)

【0109】上記ポリマーのジオキサン溶液2gにペン タエリスリトールトリアクリレートをポリマーに対して 50重量部、第1表に示したポルフィラジン系化合物を 10重量部、ジメチルシクロヘキセン誘導体 (X I V) を10重量部、オキシバナジウムアセチルアセトナトを 0、1重量部をそれぞれ添加して調製した感光液をスピ した感光板に、ビーム径2mmのHe-Neレーザー (633nm光) を照射時間を変えて露光し1mmHg 以上の真空下で60℃、3分の加熱処理を行なった後、 トルエンにて現像を行いレーザービーム径と同等の大き さの硬化スポット径を与える露光量を感度として第1表 に示した。尚、表中のポルフィラジン系化合物は前に示 した化合物 (a) ~化合物 (i) と同一物質である。 [0110] 実施例10~12

*前記実施例1~9における組成で、色素として 実施例 1に示したポルフィラジン系化合物 (a) を、光酸化性 化合物として(X I V)の代わりに以下に示す(X V) ~ (XV11) のオレフィン誘導体を用いた時の感度特 性を、第2表に示した。 [0111]

18

【表1】

第1表

実施包	ポルフィラジン系化合物	感度 (mJ/cm²)
2 3 4 5 6 7	化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化	0. 52 0. 075 0. 15 1. 798 0. 23 5. 10 1. 60

20

[0 1 1 2] [表2]

第2多

実施例	光酸化性化合物	感度 (mj/cm²)
1 0	(XV)	0.63
11	(X V 1)	0.32
1 2	(XVII)	1. 50

[0113]式(XV)

(4k.291

(0114]式(XVI)

[4:30]

[0115]式(XVII) (化31)

[0116]

【発明の効果】本発明における光開始剤組成物は、カー ポンアーク、キセノンランプ、メタルハライドランプ、 蛍光ランプ、タングステンランプなどを用いることがで きるほか、600mmから720mmまでの波長の光に 対して高い感度 (0. 1 m J / c m² ~数 m J / c m²)を示すことから、He-Ne、Kr レーザーな 30 どのガスレーザーや、半導体レーザーを用いることがで きる。

[0118] また、レーザービーム走査による高速スキ ャニング露光においても相反則不軌挙動を示さないの で、レーザーピーム走査による画像形成材料、例えばダ イレクト制版、プリント配線板用フォトレジスト、非銀 塩属像形成材料などに応用可能であり、また、微妙な干 渉縞形成のため高感度であることが要求されるリップマ ン型ホログラムや、大面積化が困難であったレインポー ホログラムにおけるレリーフ型ホログラム記録における 40 ホログラム記録用材料などとして幅広い分野に応用可能 である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5 // G03C 1/675 禁用記号 庁内整理番号 A 8910-2H

FΙ

技術表示箇所